CLIPPEDIMAGE= JP405102384A

PAT-NO: JP405102384A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 05102384 A

TITLE: METHOD OF MANUFACTURING RESIN SEALING TYPE

SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: April 23, 1993

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KUDO, YOSHIMASA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOSHIBA CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP03261641

APPL-DATE: October 9, 1991

INT-CL (IPC): H01L023/50; B23K026/00; H01L021/60

US-CL-CURRENT: 257/672,257/692

ABSTRACT:

PURPOSE: To form a lead having a minute pitch by a method wherein an electrode of a semiconductor chip is connected to a tip of a lead frame inner lead, a coupling part is cut by laser-machining, and each inner lead is electrically made independent.

CONSTITUTION: A tip of a lead frame inner lead 4 is thinned to form a platethinned part 4a, and further a coupling part 4b is provided at a tip of the lead frame inner lead 4. A TAB outer lead 2b of a TAB chip and the lead frame inner lead 4 are performed thermocompression bonding, and the TAB chip after a

09/27/2002, EAST Version: 1.03.0002

semiconductor chip is mounted is mounted W a lead frame 7. Next, the coupling part 4b is cut by using a laser to separate the lead frame inner lead 4 and electrically made independent each other. Thus, the tips

of the lead frame inner leads can minutely be processed and the leads can be connected at narrow

lead pitches.

COPYRIGHT: (C) 1993, JPO& Japio

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-102384

(43)公開日 平成5年(1993)4月23日

(51)Int.Cl. ⁵		識別記号		庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H01L	23/50		R	9272-4M		
B 2 3 K	26/00		Н	7920-4E		
H01L	21/60	3 1 1	R	6918-4M		
	23/50		В	9272-4M		

審査請求 未請求 請求項の数3(全 5 頁)

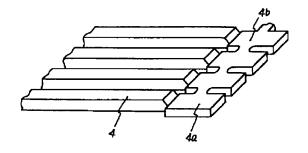
(21)出願番号	特顧平3-261641	(71)出額人	000003078
(22)出顧日	平成 3年(1991)10月 9日		株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
(22)四殿日	十版34(1 33 1/10/1 3 日	(72)発明者	工藤 好正
			神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 番地 株式会社東芝多摩川工場内
		(74)代理人	弁理士 則近 憲佑

(54) 【発明の名称 】 樹脂封止型半導体装置の製造方法

(57)【要約】

【構成】 リードフレームインナーリード先端部を薄肉化し、リードフレームインナーリード先端部を繋ぐ連結部を残してリードフレームインナーリードを成形する工程と、半導体チップと前記リードフレームインナーリードとを接続する工程の後、前記連結部をレーザー加工によって切断する工程とを有する。

【効果】 リードフレームインナーリードの先端部を薄肉化することにより、より微細なピッチのリードを形成することが可能になり、リードフレームインナーリードの先端部に連結部を形成することで、リード幅の小さなインナーリードの先端部まで変形を確実に防止できるので、TAB技術を用いたフラットパッケージにおいて、TABアウターリードとリードフレームインナーリードとの接続を良好に行うことができる。また、連結部をレーザー加工によって切断することによって、よりリード幅、リードピッチの狭いリード接続を可能にする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】肉薄の先端部を有し、その隣接する先端部 が連結部で繋がれたリードフレームインナーリードを成 形する工程と、

半導体チップの電極と前記リードフレームインナーリー ドの先端部とを接続する工程と、

その後、前記連結部をレーザー加工によって切断し、各 インナーリードを電気的に独立させる工程とを有するこ とを特徴とする樹脂封止型半導体装置の製造方法。

が連結部で繋がれたリードフレームインナーリードを成 形する工程と、

半導体チップの電極とテープフィルムキャリアのTAB リードとを接続する工程と、

その後、前記リードフレームインナーリードと前記テー プフィルムキャリアのリードとを接続する工程と、

次に、前記連結部をレーザー加工によって切断し、各イ ンナーリードを電気的に独立させる工程とを有すること を特徴とする樹脂封止型半導体装置の製造方法。

の全てが前記連結部によって一体的に連結されているこ とを特徴とする特許請求の範囲請求項1または請求項2 記載の樹脂封止型半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体装置の製造方法 のうち、特に、樹脂封止型半導体装置の製造方法に関す る。

[0002]

フレーム中央に半導体チップを位置し、リードフレーム 中央に突出するリードフレームインナーリードと半導体 チップ上の電極パッドを金等の金属ワイヤによって接続 し、この後、樹脂封止している。

【0003】しかし、半導体チップのサイズが小さくな り、また、ピン数が増大するにつれて、リードフレーム インナーリード先端の幅、ピッチが狭くなるため、リー ドフレームインナーリードを一定の強度を保ったまま半 導体チップ近くまで延ばすことができなくなっている。 とせないために、板厚が最小ピッチを決めるからで、リ ードフレームインナーリード板厚を厚くして強度を維持 すると、微小ピッチの加工が不可能であり、また、微小 ピッチ加工のためにリードフレームインナーリード板厚 を単純に薄くすると強度の点で問題が生じる。従って、 リードフレームインナーリード先端と電極パッドとの距 離が大きくならざるをえず、ボンディングワイヤが著し く長くなり、ワイヤ同士の接触や断線による不良が発生 しやすくなる。また、リードフレームインナーリードの ピッチを狭くするとボンディングエリアが微小となり、 2

ミスポンドを誘発し、歩留まりを低下させる。

【0004】この問題の解決手段として、図6に示すよ うなTAB技術を応用したフラットパッケージのひとつ として、QFP (Quadrangular Flat Package) が開発 されている。

【0005】例えば、TAB技術を用いたQFPはま ず、通常のTAB方式により電極パッド5とTABイン ナーリード2aを圧着し、テープフィルムキャリア3上 のTABリード2に半導体チップ1を接続する。次に、 【請求項2】肉薄の先端部を有し、その隣接する先端部 10 TABアウターリード2bとリードフレームインナーリ ード4とを位置合わせし、プレス加工により熱圧着接続 し、この後、樹脂封止する。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】従来のワイヤボンディ ング法ではリードフレームインナーリードの位置を検出 してリードのある場所にボンディングしてゆくが、TA B技術を用いたQFP等では、TABアウターリードと リードフレームインナーリードを重ねて、一括または個 々に熱圧着接続する。従って、ワイヤボンディング法で 【請求項3】前記リードフレームインナーリード先端部 20 はリード位置の精度はあまり問題にはならないが、TA B技術を用いたQFP等では、テープフィルムキャリア に半導体チップを装着後のTABチップの位置が決まる と、TABアウターリード、リードフレームインナーリ ードともリード幅、ピッチが決まっているため、全ての TABアウターリード、リードフレームインナーリード の位置が一義的に決まり、一括接続、個々接続に係わら ず、リードの変形は即接続不良となる。即ち、各々のリ ードの位置精度は極めて重要である。現在、300 ピン程 度の半導体チップではリードフレームインナーリードの 【従来の技術】従来のワイヤボンディング法ではリード 30 厚さは0.15mm程度で、各々のリードの幅は0.12mm、ピッ チは0.1mm 程度、また、求められるTABアウターリー ドの位置精度は±0.015mm 程度、リードフレームインナ ーリードの精度は±0.02m程度である。

> 【0007】今日、半導体チップの集積度の向上にとも なって一層多ピン化が進んでおり、このためTABを用 いたQFP等においてもリードフレームインナーリード のピッチが一層狭くなり、リード幅も小さく、変形しや すくなっている。

【0008】このリードフレームインナーリードの変形 これは、現状では板厚の70%程度までの間隔しか抜き落 40 防止のためにポリイミドテープでリードを固定している が、ポリイミドは絶縁物質であるため、リードフレーム インナーリードの先端部に用いることができない。この ため、ポリイミドテープを用いてもリード先端部の変形 を確実に防ぐことはできない。さらにまた、ポリイミド テープは高価である。

> 【0009】以上述べてきたように、リードフレームイ ンナーリードの位置精度条件は非常に厳しくリードフレ ームインナーリードのわずかな変形が品質に大きな影響 を与えるため、安価で確実なリードフレームインナーリ 50 一ド変形防止法が望まれている。

[0010]

【課題を解決するための手段】上述の問題点を解決する ため、本発明は、肉薄の先端部を有し、その隣接する先 端部が連結部で繋がれたリードフレームインナーリード を成形する工程と、半導体チップの電極と前記リードフ レームインナーリードの先端部とを接続する工程と、そ の後、前記連結部をレーザー加工によって切断し、各イ ンナーリードを電気的に独立させる工程とを有すること を特徴とする樹脂封止型半導体装置の製造方法を提供す る。また、肉薄の先端部を有し、その隣接する先端部が 10 連結部で繋がれたリードフレームインナーリードを成形 する工程と、半導体チップの電極とテープフィルムキャ リアのTABリードとを接続する工程と、その後、前記 リードフレームインナーリードと前記テープフィルムキ ャリアのリードとを接続する工程と、次に、前記連結部 をレーザー加工によって切断し、各インナーリードを電 気的に独立させる工程とを有することを特徴とする樹脂 封止型半導体装置の製造方法を提供する。ここで、前記 リードフレームインナーリード先端部の全てが前記連結 部によって一体的に連結されていても良い。

[0011]

【作用】現在、板厚の70%程度までのピッチでリードを加工できることから、リードフレームインナーリードの 先端部を薄肉化することにより、より微細なピッチのリードを形成することができる。また、隣接するリードフレームインナーリード先端部を互いに連結部で繋ぐことにより、互いに補強し合い、リード幅の小さなインナーリードの先端部まで、変形を防止する。

【0012】そして、リードフレームインナーリードと 半導体チップの電極パッドまたはTAB技術を用いて半 導体チップをテープフィルムキャリアに装着したTAB チップのTABアウターリードを接続後、連結部をレー ザー加工し、切断することによってリードフレームイン ナーリードを互いに電気的に独立させる。

[0013]

【実施例】以下、本発明の実施例を図1から図5を参照 しながら詳細に説明する。

【0014】図1はTABアウターリードを接合前のリードフレームインナーリード先端部を示す図である。図2はリードフレームインナーリードの接合部分のレーザ 40一加工前を示す部分平面図、図3は図2のAA'に沿う断面図、図4はTABアウターリードとリードフレームインナーリードとの接合部分のレーザー加工後を示す部分平面図である。また、図5はリードフレームを示す図である。

【0015】まず、図5に示すように、Cu系合金またはFe-Ni合金からなる帯状薄板を加工し、リードフレームインカールーム7を形成する。即ち、帯状薄板中央に半導体チップ配置部6を設け、コイニングまたはハーフエッチングはよって半導体チップ配置部6周囲を帯状薄板厚の1/50 インナーリード4との位置合わせを良好に行うことが可

4

3~2/3に薄肉化し、リードフレームインナーリード 先端部に図1に示すような薄板化部4aを形成する。 【0016】続いて、リードフレームインナーリード4 及び薄板化部4 aの一部分を残して帯状薄板厚の70~80 %の間隔で抜き落とし、リードフレームインナーリード の先端部を互いに連結する連結部4bを形成する。連結 部4bは全てのリードフレームインナーリード先端を一 体的に連結するものであっても、一連の群を成すリード フレームインナーリード先端を部分的に連結するもので あっても良い。現状では板厚の70%程度までの間隔を抜 き落とすことができることから、板厚が最小ピッチを決 めることになる。即ち、リードフレームインナーリード 4先端部を薄肉化し、薄板化部4aを形成することによ り、今日の手法を用いてさえも、さらに微細なピッチの リードフレームインナーリード4を形成することが可能 である。 即ち、 リードフレームインナーリード4の厚さ が0.15mmであれば、リード間隔は0.1mm 程度が限界であ るが、薄板化部4aを0.05mm程度に加工することによ り、リード間隔は0.04㎜程度まで微細化可能である。ま 20 た、リードフレームインナーリード4先端部に連結部4 bを設け、リードフレームインナーリード先端部を互い に連結することにより、リードフレームインナーリード 4先端部を安定させることができ、薄肉化しても、極め て精度良くリードフレームインナーリード4を整形でき る。特に、全てのリードフレームインナーリード先端部 を一体的に連結した場合にはリードフレームインナーリ ードの安定性を一層増すことができる。

> 【0018】一方、半導体チップは従来のTAB技術に よって、テープフィルムキャリア3に装着する。即ち、 半導体チップ上の電極パッドとTABインナーリードを 熱圧着し、接続する。この後、所定の電気検査を行い、 TABアウターリード2b外周部を切断することによ り、半導体チップを装着したTABチップを形成する。 【0019】続いて、図2及び図3に示すように、TA Bチップをリードフレーム7に位置合わせし、TABチ ップのTABアウターリード2bとリードフレームイン ナーリード4を熱圧着して、この半導体チップを装着後 のTABチップをリードフレーム7に装着する。このと き、TABアウターリード2bのリード幅、ピッチが決 まっているため、TABチップをリードフレーム7に位 置合わせしたときに、全てのTABアウターリード2b の位置も一義的に決まる。しかし、リードフレームイン ナーリード4には連結部4bがあるため、リードフレー ムインナーリード4の変形を確実に防止することがで き、全てのTABアウターリード2bとリードフレーム

能となる。

【0020】次に、連結部4bを、例えばYAG等のレーザーを用いて切断し、図4のように、リードフレームインナーリード4を分離して、TABアウターリード2bとリードフレームインナーリード4の接続処理を完了する。このとき、レーザー光を有効に作用させるために、薄板化部4aを着色するなどして、レーザー光を吸収しやすくしておいても良い。このようにして、レーザー光を用いることによって、極めて微細な加工が可能になり、リードフレームインナーリード4のピッチを先端10部で小さくすることができる。従って、抜き落としだけでは不可能であったようなピッチも、薄肉化した連結部4bを切断することによって実現することができる。

【0021】この後、従来のQFPと同様にして、リードフレーム7を樹脂封止し、リードフレームアウターリード4cを所定の形状にトリミイング及びフォーミングして、半導体装置を完成する。

【0022】以上では、TAB技術を用いたQFPについて述べてきたが、他の形状のTAB技術を用いたフラットパッケージについてもまったく同様にして本発明を 20 用いることができる。さらに、通常のワイヤボンディングにおいても、リードフレームインナーリード先端部を薄肉化し、連結部を設けておき、ボンディング後、レーザーによって連結部を切断するという方法等も可能である。

[0023]

【発明の効果】抜き落としまたはエッチングによってリードフレームインナーリードを成形する場合、リード板厚がリードの加工可能なピッチを決定するため、リードフレームの板厚が薄いほど微細なピッチで形成すること 30ができる。従って、リードフレームインナーリードの先端部を薄肉化することにより、より微細なピッチのリードを形成することができる。

【0024】隣接するリードフレームインナーリードの 先端部を繋ぐ連結部を形成することにより、リード幅の 小さなインナーリードの先端部まで変形を確実に防止で きるので、リードフレームインナーリード先端部を薄肉 化しても、TAB技術を用いたフラットパッケージにおいて、TABアウターリードとリードフレームインナー リードとの接続を良好に行うことができる。

【0025】また、リードフレームインナーリードと半導体チップの電極パッドまたはTAB技術を用いたTABチップのTABアウターリードを接続後、連結部をレーザー加工によって切断することによって、リードフレームインナーリード先端部の微細な加工が可能となり、よりリード幅、リードピッチの狭いリード接続を可能にする。

【図面の簡単な説明】

【図1】リードフレームインナーリードの先端部を示す 図である。

【図2】リードフレームインナーリードとTABアウターリードとの接合部分のレーザー加工前を示す平面図である。

【図3】図2中AA'に沿う断面図である。

【図4】リードフレームインナーリードとTABアウターリードとの接合部分のレーザー加工後を示す平面図である。

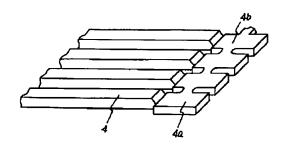
【図5】リードフレームを示す図である。

【図6】従来のTAB技術を用いたQFPの樹脂封止前の断面図である。

【符号の説明】

- 1 半導体チップ
- 2 TABU-K
- 2a TABインナーリード
- 2b TABアウターリード
- 3 テープフィルムキャリア
- 0 4 リードフレームインナーリード
 - 4 a 薄板化部
 - 4 b 連結部
 - 4c リードフレームアウターリード
 - 5 電極パッド
 - 6 半導体チップ配置部
 - 7 リードフレーム

【図1】



【図2】

